

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA E), DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E AVVIO OPERATIVO DI UN SISTEMA DI REACTIVE ION ETCHING (RIE) PER L'INCISIONE DI PATTERN SU FILM SOTTILI DI SI, SIO, NB, W, MO PER APPLICAZIONI NEL CAMPO DELLA MICRO- E NANO-ELETTRONICA NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.3 - PARTENARIATI ESTESI A UNIVERSITÀ, CENTRI DI RICERCA, IMPRESE E FINANZIAMENTO PROGETTI DI RICERCA, PROGETTO NQSTI, SPOKE 4, CUP B53C22004180005 CIG B4B0EEFBD5 – COMUNICAZIONE CHIARIMENTI N° 1

Riferimento: <https://www.urp.cnr.it/474457-2024>

Quesito: ...omissis... *Nel capitolato tecnico, al punto 2.2.5.ii, è richiesta un'alimentazione di 220V AC. È possibile offrire soluzioni differenti (es. 3x400V)? ... omissis...*

Risposta: In ossequio al principio del *favor participationis* nonché del principio di equivalenza delle soluzioni è ammesso proporre una soluzione differente relativamente al requisito dell'alimentazione, ossia 3x400V in luogo di 220V monofase.

Il Responsabile unico del progetto
(Marco Campani)